

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-119203

(43)Date of publication of application: 18.05.1993

(51)Int.CI.

G02B 3/00 B29D 11/00

G02B 6/12

(21)Application number: 03-277687

(71)Applicant: FI

FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

24.10.1991

(72)Inventor:

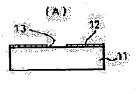
MIURA KAZUNORI

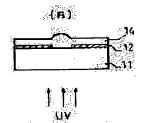
(54) MICROOPTICAL LENS AND PRODUCTION OF OPTICAL WAVEGUIDE

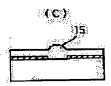
(57)Abstract:

PURPOSE: To narrow the spacing between a substrate and a photomask and to form the microlens or optical waveguide having high reliability by forming a polymer thin film contg. a photopolymerizable monomer on the photomask and irradiating the substrate with UV rays from its rear surface direction to photopolymerize a photopolymerizable monomer.

CONSTITUTION: Ti is deposited by evaporation on one surface of the glass substrate 11 to form the mask 12. A window 13 of the shape complying with the microlens to be formed is then patterned and is formed in the mask 12 by using a photolithography technique. A thin film 14 is then formed on the photomask 12 by spin coating using a mixture composed of vinyl carbazole, polyacrylate and sellosolve acetate. The glass substrate 11 is then irradiated with the UV rays from its rear surface. The polymn and diffusion of the vinyl carbazole are caused by this irradiation and the microlens 15 is formed. Finally, the polymer is subjected to post baking and is thereby completely cured, by which the optical microlens 15 is formed.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-119203

(43)公開日 平成5年(1993)5月18日

(51)Int.Cl.5

識別配号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 3/00 Z 8106-2K

B 2 9 D 11/00

7148-4F

G 0 2 B 6/12

M 7036-2K

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-277687

平成3年(1991)10月24日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 三浦 和則

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 青木 朗 (外3名)

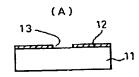
(54)【発明の名称】 微小光学レンズおよび光導波路の製造方法

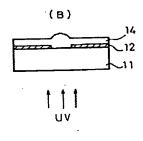
(57)【要約】

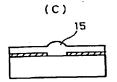
【目的】 基板とフォトマスクの間隔を極めて狭くして 信頼性の高い微小レンズ又は光導波路の作成を可能とす る。

【構成】 上記目的達成のため、基板上にフォトマスク を形成し、該フォトマスクをパターン化し、該パターン 化したフォトマスク上に光重合性モノマーを含有するポ リマー薄膜を形成し、次いで、基板の裏面方向から紫外 線を照射して該光重合性モノマーを光重合させるように 構成する。

本発明方法の一例による微小レンズの作成工程







30

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 紫外線照射によるモノマーの拡散を利用した微小光学レンズの製造方法であって、基板上にフォトマスクを形成し、該フォトマスクをパターン化して製作すべき微小レンズにみ合う形状の窓を形成し、該パターン化したフォトマスク上に光重合性モノマーを含有するポリマー薄膜を形成し、次いで、基板の裏面方向から紫外線を照射して該光重合性モノマーを光重合させることを特徴とする、微小光学レンズの製造方法。

【請求項2】 紫外線照射によるモノマーの光重合を利用した光導波路の製造方法であって、基板上にフォトマスクを形成し、該フォトマスクをパターン化して製作すべき光導波路にみ合う形状の窓を形成し、該パターン化したフォトマスク上に光重合性モノマーを含有するポリマー薄膜を形成し、次いで、基板の裏面方向から紫外線を照射して該光重合性モノマーを光重合させることを特徴とする、光導波路の製造方法。

【請求項3】 パターン化したフォトマスクとポリマー 薄膜との間にクラッド層を介装させることを特徴とする 請求項2の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、微小光学レンズおよび 光導波路の製造方法に関し、更に詳しくはフォトリソグ ラフィー技術を利用したプラスチック製の微小光学レン ズおよび光導波路の製造方法に関する。

[0002]

【従来技術および発明が解決しようとする課題】光通信は、広帯域、低損失、軽量等の優れた性質をもつ。このため、近年、特に中・長距離大容量通信、飛行機や船舶内の通信、工場内通信等に応用されてきている。近年、微小光学レンズや光導波路は、このような光通信、あるいは光情報処理に用いられる光回路において、光素子間の結合、光の合波分波等への応用あるいは配線部品、更には光集積回路における光導波路レンズへの応用等が高まっている。

【0003】ところで、このような微小光学レンズおよび光導波路の作製方法として、近年、5図および7図に示すような工程プロセスが提案されている。すなわち、5図および7図にそれぞれ示すようにガラス基板1に(5図(A)、7図(A))、光重合性モノマーを含有するポリマーの薄膜2をスピンコート法等により形成し(5図(B)、7図(B))、次いで該薄膜2の上方にフォトマスト3を設置する。次いで紫外線等を露光源として薄膜2の選択露光を行い(5図(C)、7図

(C))、それぞれ微小レンズ(6図)および光導波路(8図)を得る。しかるに、このような従来方法で微小レンズ等を作成する場合、その作成過程において薄膜の露光部分において、重合性モノマーのポリマー化が進行しその結果、体積が膨張し凸部が形成される。この凸部

が成長するとフォトマスクと接触したり、あるいはフォトマスクにくっついたりする。従って、従来方法では基板1とフォトマスク3との間隔を小さくすることができないという欠点があった。従って、従来方法による場合、微細なレンズおよび光導波路の製作が困難であった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、かかる従来の問題点を解決するためになされたものであり、本発明の微小光学レンズの製造方法は、基板上にフォトマスクを形成し、該フォトマスクをパターン化して形成すべき微小レンズにみ合う形状の窓を形成し、該パターン化したフォトマスク上に光重合性モノマーを含有するポリマー薄膜を形成し、次いで、基板の裏面方向から紫外線を照射して該光重合性モノマーを光重合させることを特徴とする。更にまた、本発明の光導波路の製造方法は基板上にフォトマスクを形成し、該フォトマスクをパターン化したフォトマスク上に光重合性モノマーを含有するポリマー薄膜を形成し、次いで、基板の裏面方向から紫外線を照射して該光重合性モノマーを光重合させることを特徴とする。

【0005】このような本発明の第一の方法(微小光学 レンズの製造方法)および第二の方法(光導波路の製造 方法) において、ポリマーとして、可視域で透明であ り、かつ光重合性モノマーを溶解し得るポリマー、例え ばポリアクリレート等が好ましく用いられ、また光重合 性モノマーとしては例えば透明であり、重合したときの 屈折率が該ポリマーの屈折率よりも大きいモノマー例え ばビニルカルバゾール等が好ましく用いられる(ポリア クリレートの屈折率は1.49であるのに対し、ポリビ ニルカルバゾールの屈折率が1.67と大きい)。本発 明では、光重合性モノマーを含んだポリマーの薄膜形成 後、微小レンズ光導波路形成のため選択露光を行う。こ の選択露光は、微小レンズ又は光導波路形成部位に窓を あけたフォトマスクを使用して、薄膜の組成等のファク ターに依存するいろいろな露光源で行なうことができ る。一般に、約280~450mmの波長を有する紫外線 光を露光源として有利に使用することができる。露光強 度は、好ましくは、約40~400mW/cm² である。露 光時の温度は、使用する光重合性モノマーによって任意 に変えることができる。本発明方法では、露光部分に存 在するポリマー中の光重合性モノマーが、露光により重 合および拡散が生じ窓の形状に応じ微小レンズ又は光導 波路が作成できる。なお、本発明方法においては、パタ ーン化したフォトマスクとポリマー薄膜との間にクラッ ド層を介装することもできる。これは、金属(マスク) に伝搬光が接触すると伝搬損失が大きくなるので、これ を有効に防止するためである。以下、更に図1~図4に 基づき本発明の実施例を説明するが、本発明がこれらの 3

実施例に限定されないことはもとよりである。

[0006]

【実施例】

実施例1

図1は、本発明の微小レンズの製造工程を示す図であ り、図2はこの実施例により得られた微小レンズの斜視 図である。まず、ガラス基板11の一方の表面にマスク 材としてTiを蒸着してマスク12を形成する。次いで フォトリソグラフィー技術を用い作成すべき微小レンズ にみ合う形状の窓13をパターン化して該マスク内に形 10 成する。なお、Tiのエッチャントとしてフッ酸:硝 酸:水=1:1:50を用いた。次に、ビニルカルバゾ ール (15%) 、ポリアクリレート (35%) およびセ ルソルブアセテート(溶剤:50%)の混合剤を用い て、スピンコート(1500rpm , 30sec)により該 フォトマスク上に薄膜 (10μm) 14形成した。次い でガラス基板の裏面より紫外線 (λ=365nm) を照射 した。この照射により、ビニルカルバソールの重合およ び拡散が生じ、微小レンズが形成された。最後にポスト ベーク (180℃、30分) を行い、完全にポリマーを 20 硬化させ、微小光学レンズ15を作成した(2図)。

【0007】実施例2

図3は本発明の光導波路の製造工程を示す図であり、図 4はこの実施例により得られた光導波路の斜視図であ る。まずガラス基板21の一方の表面にマスク材として Tiを蒸着してマスク22を形成する。次いでフォトリ ソグラフィー技術を用い作成すべき光導波路にみ合う形 状の窓23を形成する。なお、Tiのエッチャントとし てフッ酸:硝酸:水=1:1:50を用いた。次に、ク ラッド層として屈折率n=1.49のポリアクリレート 30 (40%) およびセルソルブアセテート(溶剤:60 %) の混合剤を用いて、スピンコート(3000rpm, 30sec)によりクラッド層(5 μm)24を形成し、 ポストベーク (180℃、30分)を行い、完全に硬化 させた。次に、コア層としてビニルカルパゾール(15 %)、ポリアクリレート(35%)およびセルソルブア セテート(溶剤:50%)の混合剤を用いて、スピンコ ート (3000 rpm , 30 sec) により薄膜25を(6 µm) を形成し、プリベーク (80℃、30分) を行っ た後、ガラス基板の裏面より紫外線(λ = 3 6 5 nm)を 40 照射した。この照射により、ビニルカルバゾールの重合 が生じ、光導波路26が形成された。エタノール中で未 反応のビニルカルバゾールモノマーを除去した後、ポス トベーク(180℃、30分)を行い、完全に硬化させ

た。このような方法により屈折率n=1.67のポリビニルカルバゾールをドープしたポリアクリレートからなる光導波路(コア)26が得られ、また、n=1.49のポリアクリレートからなるクラッドが得られる。このような方法で得られた屈折率nの異なる光学素子は、光通信用に好ましく使用可能である。

[0008]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成されるものであるから、基板とフォトマスクとの間隔を問題にすることもなく、微細な光学レンズおよび光導波路の製造が可能となる。更に、従来方法におけるようにポリマー薄膜が不必要にフォレジストに接触する心配もない。従って微小レンズ又は光導波路の製造における量産性・信頼性が向上し、低価格化が実現可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明方法の一例による微小レンズの作成工程 を示す工程図である。

【図2】本発明方法の一例により得られる微小レンズの斜視図である。

【図3】本発明方法の一例による光導波路の作成工程を 示す工程図である。

【図4】本発明方法の一例により得られる光導波路の斜 視図である。

【図5】従来方法の一例による微小レンズの作成工程を 示す工程図である。

【図6】従来方法の一例により得られる微小レンズの斜 視図である。

【図7】従来方法の一例による光導波路の作成工程を示す工程図である。

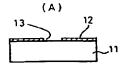
【図8】従来方法の一例により得られる光導波路の斜視 図である。

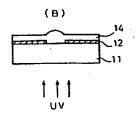
【符号の説明】

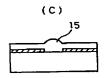
- 11…ガラス基板
- 12…マスク
- 13…窓
- 14…薄膜
- 15…微小レンズ
- 21…ガラス基板
- 22…マスク
- 23…窓
- 24…クラッド層
- 25…薄膜
- 26 …光導波路

【図1】

本発明方法の一例による微小レンズの作成工程

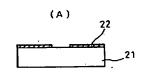


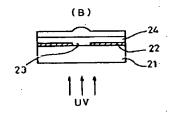


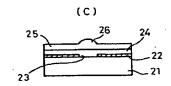


【図3】

本発明の一例による光導設路の作成工程

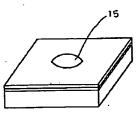






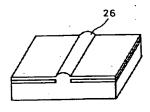
[図2]

本発明方法の一例により得られた殷小レンズの斜視図



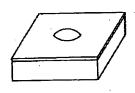
【図4】

本発明方法の一例により得られた光導波路の斜視図



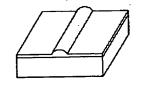
【図6】

従来方法で作成した微小レンズの斜視図



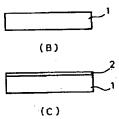
【図8】

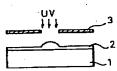
従来方法で作成した光導波路の斜視図





従来方法による微小レンズの作成工程 (A)





【図7】

従来方法による光導放路の作成工程 (A)

